【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成17年8月11日(2005.8.11)

【公開番号】特開2005-107551(P2005-107551A)
【公開日】平成17年4月21日(2005.4.21)
【年通号数】公開・登録公報2005-016
【出願番号】特願2004-375898(P2004-375898)
【国際特許分類第７版】
　Ｇ０３Ｆ　 1/08
　Ｇ０３Ｆ　 7/20
　Ｈ０１Ｌ　21/027
【ＦＩ】
　Ｇ０３Ｆ　 1/08　　Ａ
　Ｇ０３Ｆ　 7/20　　５２１
　Ｈ０１Ｌ　21/30　　５２８

【手続補正書】
【提出日】平成17年3月17日(2005.3.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１６】
　請求項１～１０のいずれか１つに記載のパターン形成方法において、
　前記フォトマスクにおいて、前記位相シフト領域の前記光透過領域に対する位相差は、前記透過性基板における前記位相シフト領域以外となる部分の上に位相シフター層が形成されることによって設けられており、
　前記位相シフター層は、前記遮光膜領域における前記遮光膜の上側に形成されていることを特徴とするパターン形成方法。